

反應式離子蝕刻機

csun

Reactive Ion Etching System

PRSM-BR10 / B27R30



機台特點 Characteristics

- 腔體內特殊流場設計提高電漿均勻性
Special gas flow design in chamber enhance plasma uniformity.
- 適用6、8、12 inch wafer或者方形尺寸(配合部件調整)
Available for 6 inch, 8 inch, 12 inch wafers, or panels (with a conversion kit).
- 單次製程多片產出提升WPH
Producing multiple wafers in the same process enhances WPH.
- 高頻電漿應用，有效提升製程效率並降低電漿損傷
High frequency plasma application can enhance process efficiency and reduce plasma damage.
- 製程用途廣泛，包含清潔、光阻去除以及蝕刻
Wide application including cleaning, stripping and etching.
- 單一系電漿統單次製程多片產出，最經濟化的選擇
Best choice for economy, as one system can produce multiple wafers in a single process.



www.csun.com.tw

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment

PRSM-BR10 / B27R30 反應式離子蝕刻機

設備電力規格 Power	220V 3φ 50/60 Hz 14kVA (PRSM-BR10) 220V 3φ 50/60 Hz 18.3kVA (PRSM-B27R30)
腔體材質 Material of chamber	Aluminum alloy
腔體內部尺寸 Interior chamber (mm)	W 700mm x D 640mm x H 250mm
電漿源 Plasma source	RIE mode
射頻電源電力規格 Generator power	13.56 MHz, 1kW (PRSM-BR10) 27.12 MHz, 3kW (PRSM-B27R30)
製程氣體 Process gas	Ar、O ₂ 、CF ₄ 、Mixture (Max. 4 gas lines)
氣體流量控制 Gas flow control	MFC (±1% of set point) 註: 流量設定≥全流量40%, 控制精度為±1% of set point, <40%時控制精度為±0.4% of full scale Note: Control accuracy ±1% of set point when flow rate ≥40%, control accuracy ±0.4% of full scale when flow rate <40%
泵浦規格 Standard pump	Dry pump, pumping speed >350 cfm @60 Hz
製程壓力計 Pressure gauge	Capacitive pressure sensor
製程壓力控制 EQ pressure	50~800 mTorr
控制系統 Control system	19.5 inch TFT panel / PC / Windows 10
設備尺寸 Dimension	W1500mm x D1300mm x H1950mm
載台溫度控制 Stage temperature controller	Chiller
規範 Compliance	SEMI S2-01, SEMI S8-01, SECS/GEM

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM2023Q3-000-TW

應用 Applications

- | | |
|---|--|
| 1. 表面活化和清潔
Surface clean & treatment | 4. 殘膠去除
Descum |
| 2. 金屬氧化還原
Metal reduction oxidation | 5. 聚合物去除
Polymer removal |
| 3. 光阻剝除
PR Stripping | 6. 氧化矽/氮化矽/矽蝕刻
SiO _x / SiN _x / Si etching |

+86-159-6252-1975 (華東)

+86-136-0029-3510 (華南)

+886958-925529 (臺灣)

super.lu@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL: 886-2-26017706
FAX: 886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL: 886-4-23591651
FAX: 886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL: 86-20-86846341-3
FAX: 86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL: 86-769-85331146
FAX: 86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL: 86-512-57780230
FAX: 86-512-57780229